



NAR Labs National Applied Research Laboratories
Taiwan Semiconductor Research Institute

L22 高速量產型光學曝光系統 注意事項

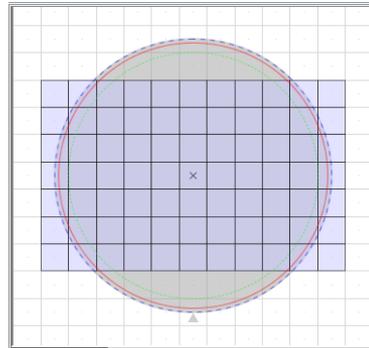
負責工程師: 黃才銘
Engineer: Tsai-Ming Huang

248 委託製程注意事項

✓ 248 曝光機目前僅接受委託代工，不開放自行操作。

✓ 248 製程規定：

- 目前248曝光機僅能接受厚度725+/-20um的整片矽晶圓進入曝光使用，破片不允許進入。
- 需有Notch，且需符合SEMI規範。
- 如有特殊需求，請與黃才銘工程師討論 (Ext: 7567)
- 目前248標準曝光如右圖所示，橫向鋪滿，上下區域會留給eBeam mark使用。如有特別需求，請洽工程師。



✓ 248 代工規定：

- 如有之前做過的紀錄，且欲重複該製程，建議註明上次製程時間，以利複製。
- 光罩請當面交給代工人員，並於製程結束後2天內取回，代工人員不負保管責任。
- 送件前，請先用IPA擦拭晶背，確保晶背沒有髒污後再送件。





NAR Labs National Applied Research Laboratories
Taiwan Semiconductor Research Institute

End